四列屈折率分布型レンズアレイの使用によるパターン線幅異方性の解消

Problem Solving of Directional Pattern Width Difference in Projection Exposure

Using a Four-Line Gradient Index Lens Array

東京電機大学,^〇堀内敏行,鈴木岳,小林宏史

Tokyo Denki Univ.

[°]Toshiyuki Horiuchi, Takeru Suzuki and Hiroshi Kobayashi

E-mail: horiuchi@cck.dendai.ac.jp

1. まえがき マイクロレンズアレイや流体デバイスなどの 最小寸法が 10µm オーダーの大パターンを数 mm~数 10 mm 角の露光領域で形成する低廉安価な露光装置として、 屈折率分布型レンズアレイを用いた走査投影露光装置を 開発中である。コピー用などに量産されている長さ 200 ~300mm のレンズアレイを用いれば、幅広の露光領域を 容易に確保でき、走査すれば、長辺はステージのストロ ーク次第で任意に長く取れる。自作した二列のレンズア レイを用いた露光装置を用いた検討により、走査(主走査: X 方向)と直角の方向すなわちレンズアレイの配列方向に レンズアレイを往復動(副走査:Y方向)させながら走査露 光を行えば、線幅10μm以下の1:1 ライン&スペース(L&S) まで均一に形成できることが分かった¹⁾。しかし、パター ン形成特性を詳しく調べた結果、X,Y方向でパターン線 幅が若干異なることが明らかになった^{2,3}。本報告では、 二列レンズアレイを用いた場合のパターンの方位特異性 と四列レンズアレイを用いて方位特異性の解消を試みた 結果について述べる。

2. 二列屈折率分布型レンズアレイの転写特性 二列レンズ アレイ(要素レンズ径: 1.1mm、レンズ長さ: 16.29mm、作 動距離: 7.86mm、Y方向アレイ幅: 195.5 mm)を用いてFig. 1 に示す構成とし、紫外光源(住田光学, LS-165UV)により 露光した。レジストとしては約 1µm 厚のポジ型 THMR-iP3300 (東京応化工業)を用い、主走査: 0.33-0.42 mm/s、副走査: 6 mm/s、副走査往復距離: 2mm とした。照 明条件はインコヒーレント照明である。



Fig.1Scan exposure using a gradient index lens array.

Fig. 2 に、20µmL&S のパターン方向に対する線幅の相 違を示す。副走査(Y)方向の L&S パターンの方が、主走査 (X)方向の L&S よりラインパターン線幅が狭くなる。これ は、Y 方向は、要素レンズが多数並んでいるので、パタ ーンからの光がほぼ全部レンズアレイに取り込まれるの に対し、X 方向は、二列だけなので、レンズアレイに取 り込まれずに失われる光線が生ずるためと考えられる。X 方向のパターンは Y 方向より露光量が少なくなるので、 ポジ型レジストの残しパターンの線幅が広くなる。



Fig. 2 Directional width difference for 2-line lens array.

3. 四列レンズアレイによる転写特性の改善 レチクルか ら X 方向に進むレンズアレイに入ることができない光線 を減らすため、四列レンズアレイ(要素レンズ径: 1.1mm、 レンズ長さ: 14.75mm、作動距離: 16.63mm、 Y 方向アレ イ幅: 246mm)の適用を試みた。走査条件は、主走査 0.64-0.73 mm/s、副走査: 12 mm/s、副走査往復距離: 2mm とした。同じ 20µm L&S パターンに対する線幅の相違を Fig. 3 に示す。X 方向、Y 方向の L&S パターンの線幅は ほぼ同じとなり、方位特異性をなくすことができた。



Fig. 3 No directional width difference for 4-line lens array.

4. むすび 屈折率分布型レンズアレイ走査投影露光において、X 方向、Y 方向でパターン線幅に差が出る不都合は、四列レンズアレイの適用によりほぼ解消できた。

本研究の一部は、東京電機大学大学総合研究所一般研究 Q11T-01 として行なった。

- H. Kobayashi and T. Horiuchi: Jpn. J. Appl. Phys. 47, 5702 (2008).
- 2) 鈴木岳,小林宏史,堀内敏行:2011年度精密工学会東 北支部学術講演会講演論文集 p.39 (2011).
- T. Horiuchi, T. Suzuki and H. Kobayashi: Dig. MNC 2012, 2P-11-110 (2012).